#### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# I IBBIR BINANDI II BIRNA KIRI BIRNI BIRNI BIRNI IN NI BENDA KIRA KINI BIRNI BENALIBIN BIRNIK IBBIR KIRI KIRI K

#### (43) 国際公開日 2005 年4 月14 日 (14.04.2005)

#### PCT

### (10) 国際公開番号 WO 2005/033008 A1

(51) 国際特許分類7:

C01B 31/02

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/014878

(22) 国際出願日:

2004年10月1日(01.10.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-346117 2003年10月3日(03.10.2003)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 独立行政法人物質・材料研究機構 (NATIONAL INSTITUTE FOR MATERIALS SCIENCE) [JP/JP]; 〒305-0047 茨城県 つくば市 千現1丁目2番1号 Ibaraki (JP).

(72) 発明者; および

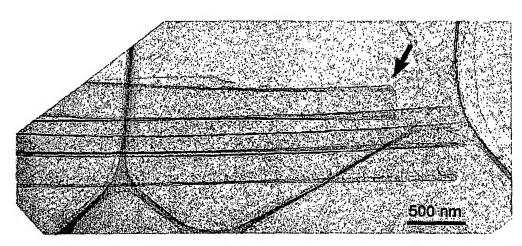
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 宮澤 薫一 (MIYAZAWA,Kun'ichi) [JP/JP]; 〒305-0047 茨城県 つくば市 千現1丁目2番1号 独立行政法人物質・材料研究機構内 Ibaraki (JP). 森 利之 (MORI,Toshiyuki) [JP/JP]; 〒305-0047 茨城県 つくば市 千現1丁目2番1号独立行政法人物質・材料研究機構内 Ibaraki (JP). 西村 睦 (NISHIMURA, Chikashi) [JP/JP]; 〒305-0047 茨城県 つくば市 千現 1 丁目 2 番 1 号 独立行政法人物質・材料研究機構内 Ibaraki (JP). 須賀 唯知(SUGA, Tadatomo) [JP/JP]; 〒305-0047 茨城県 つくば市 千現 1 丁目 2 番 1 号 独立行政法人物質・材料研究機構内 Ibaraki (JP).

- (74) 代理人: 西澤 利夫 (NISHIZAWA, Toshio); 〒107-0062 東京都 港区 南青山 6 丁目 1 1 番 1 号 スリーエフ南 青山ビルディング 7 F Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,

/続葉有/

(54) Title: FULLERENE SHELL TUBE AND METHOD FOR PRODUCING SAME

(54) 発明の名称: フラーレンシェルチューブとその製造方法



(57) Abstract: A fullerene shell tube which has wide applications such as a field emission device, gas filter, hydrogen storage material or catalyst support in the industrial fields of energy, catalyst and semiconductor is produced by heat-treating fullerene whiskers or fullerene fibers, which have been obtained by a liquid-liquid interfacial precipitation method, in vacuum or in a gas atmosphere at 500-1000°C.

(57) 要約: 液-液界面析出法によって得られたフラーレンのウィスカーまたはファイバーを真空中またはガス雰囲気中で500~1000℃の温度範囲で熱処理し、エネルギー、触媒、半導体産業における電界放射デバイス、ガスフィルター水素吸蔵体、触媒担体など幅広い用途に使用可能なフラーレンシェルチューブとする。





TD, TG).

IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

## 添付公開書類:

一 国際調査報告書